【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】令和3年9月2日(2021.9.2)

【公開番号】特開2019-17387(P2019-17387A)
【公開日】平成31年2月7日(2019.2.7)
【年通号数】公開・登録公報2019-005
【出願番号】特願2018-131485(P2018-131485)
【国際特許分類】
Ｃ１２Ｍ　3/00　(2006.01)
Ｃ１２Ｍ　1/00　(2006.01)
Ｃ１２Ｎ　1/00　(2006.01)
Ｃ１２Ｎ　5/071　(2010.01)
Ｃ１２Ｍ　1/22　(2006.01)
Ｃ０８Ｊ　7/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ１２Ｍ　3/00　Ａ
Ｃ１２Ｍ　1/00　Ａ
Ｃ１２Ｎ　1/00　Ａ
Ｃ１２Ｎ　5/071
Ｃ１２Ｍ　1/22
Ｃ０８Ｊ　7/00　３０６
Ｃ０８Ｊ　7/00　ＣＥＲ
Ｃ０８Ｊ　7/00　ＣＥＺ

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月9日(2021.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
細胞担持面を有するポリスチレンを主成分とする細胞担持用基材の製造方法であって，
加湿環境下，酸素及び／又はオゾン供給雰囲気中で，前記基材の細胞担持面にＵＶを照射するＵＶ照射工程，及び
前記基材の細胞担持面にプラズマを照射するプラズマ照射工程
を含む方法。
【請求項２】
ＵＶ照射工程の後にプラズマ照射工程を行うことを特徴とする，請求項１に記載の細胞担持用基材の製造方法。
【請求項３】
プラズマ照射工程の後にＵＶ照射工程を行うことを特徴とする，請求項１に記載の細胞担持用基材の製造方法。
【請求項４】
ＵＶ照射工程とプラズマ照射工程を同時に行うことを特徴とする，請求項１に記載の細胞担持用基材の製造方法。
【請求項５】
前記ＵＶ照射が，平均波長１８４．９ｎｍ及び２５３．７ｎｍのＵＶを照射することに

より行われることを特徴とする，請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の細胞担持用基材の製造方法。
【請求項６】
前記ＵＶ照射が，前記細胞担持面の水接触角が４０～７０°となるまでの間行われることを特徴とする，請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の細胞担持用基材の製造方法。
【請求項７】
さらに，ＵＶ照射工程の前に，該細胞担持面にアンモニア溶液を塗布する工程を備える，請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
接着細胞の培養方法であって，請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の製造方法により得られた細胞担持用基材の細胞担持面上で細胞を培養することを含む培養方法。
【請求項９】
前記接着細胞が幹細胞である，請求項８に記載の培養方法。
【請求項１０】
前記幹細胞が，マウスｉＰＳ細胞又はヒトｉＰＳ細胞である，請求項９に記載の培養方法。
【請求項１１】
フィーダー細胞の非存在下で培養することを特徴とする，請求項９又は請求項１０に記載の培養方法。
【請求項１２】
細胞担持面を有するポリスチレンを主成分とする細胞担持用基材を格納するための格納部と，該格納部に格納された前記細胞担持用基材に対して紫外線を照射可能な紫外線照射手段と，該格納部に格納された細胞担持用基材に対して窒素プラズマを照射可能なプラズマ照射手段と，前記細胞担持用基材格納部内の湿度を制御可能な加湿手段と，前記細胞担持用基材格納部内のオゾン濃度を制御可能な酸素又はオゾン供給手段を有する細胞担持用基材表面改質装置。
【請求項１３】
更に，前記細胞担持用基材の細胞担持面に対してアンモニア溶液を塗布可能なアンモニア溶液塗布手段を備える，請求項１２に記載の細胞担持用基材表面改質装置。